# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-311381

(43)Date of publication of application: 07.11.2000

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number: 2000-045449

(71)Applicant:

SHARP CORP

(22)Date of filing:

23.02.2000

(72)Inventor:

TAJIMA HIDEHARU

TAKAMORI NOBUYUKI

(30)Priority

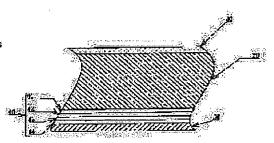
Priority number: 11046189

Priority date: 24.02.1999

Priority country: JP

#### (54) OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM

PROBLEM TO BE SOLVED: To make the deformation quantity at a temperature change smaller and to enhance the reliability of recording and reproducing by constituting an optical information recording medium in such a manner that the neutral surface at the deformation by a temperature change during recording and reproducing exists near thin-film layers, such as magnetic films. SOLUTION: The optical information recording medium has the single or multilayered thin-film layers 40 consisting of the thin films including first and second dielectric films 41 and 43, the recording film 42, a reflection film 44, etc., on a transparent substrate 20 and is formed with a thin-film protective film 50 essentially consisting of a resin on the thin-film layers 40. A substrate protective film 30 essentially consisting of a resin for protecting the transparent substrate 20 is formed on the opposite surface of the transparent substrate 20. The coefficient linear expansion, Young's modulus and film thickness of the thin-film protective film 50 formed on the thin-film layers 40 are regulated, by which the bending moment reverse from the bending moment by the transparent substrate 20 is imparted to the thin-film layers 40. The plane which is included in the thin-film layers 40 and is parallel to the film plane is formed as the neutral plane of the deformation. As a result, the deformation due to the temperature change is suppressed.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

03.07.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

### (19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-311381 (P2000-311381A)

(43)公開日 平成12年11月7日(2000.11.7)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 7/24

5 2 2

G11B 7/24 5 2 2 A

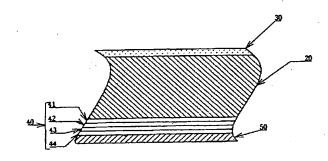
#### 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 11 頁)

(21)出願番号	特願2000-45449( P2000-45449)	(71)出願人	000005049
			シャープ株式会社
(22)出顧日	平成12年2月23日(2000.2.23)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者	田島 秀春
(31)優先権主張番号	特顯平11-46189		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
(32)優先日	平成11年2月24日(1999.2.24)		ャープ株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	高森 信之
•			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
			ャープ株式会社内
		(74)代理人	100102277
			弁理士 佐々木 晴康 (外2名)

#### (54) 【発明の名称】 光情報記録媒体

#### (57)【要約】

【課題】 温湿度変化に伴う変形(反り)を防止でき、 且つ、その製造が容易な光情報記録媒体を提供する。 【解決手段】 光情報記録媒体10は、透明基板20 と、透明基板20上に形成され記録膜42を含む薄膜層 40と、薄膜層上40に形成された薄膜保護膜50と、 透明基板20上に形成された基板保護膜30を有してい る。この光情報記録媒体10の温度変化に起因する変形 の中立面は薄膜層40内にある。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において

1

記録再生時の温度変化による膜厚方向の変形の中立面が 前記薄膜層近傍にあることを特徴とする光情報記録媒 体。

【請求項2】 透明基板と、該透明基板上に形成され記 10 録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜 層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜 保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体におい て

前記薄膜層近傍において、膜厚方向におけるその両側から受ける曲げモーメントが、略等しいことを特徴とする 光情報記録媒体。

【請求項3】 透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜 20 保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において

前記薄膜保護膜は、そのヤング率及び線膨張係数の少な くとも一方が前記透明基板よりも大きいことを特徴とす る光情報記録媒体。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の光情報記録媒体において、

前記薄膜保護膜の膜厚が、20μm以下であることを特 徴とする光情報記録媒体。

【請求項5】 透明基板と、該透明基板上に形成され記 30 録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜 層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜 保護膜と、前記透明基板の光入射側に形成された樹脂を 主成分とする基板保護膜と、を少なくとも有する光情報 記録媒体において、

前記薄膜保護膜の透湿度より前記基板保護膜の透湿度が 小さいことを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項6】 請求項5 に記載の光情報記録媒体において、

記録再生時の温度変化による膜厚方向の変形の中立面が 40 前記薄膜層近傍にあり、且つ、前記薄膜保護膜の膜厚 が、前記基板保護膜の膜厚よりも厚いことを特徴とする 光情報記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、情報を記録又は 再生する光情報記録媒体に関し、特に、環境変化や経時 変化による反りを抑制できる光情報記録媒体に関する。 【0002】

【従来の技術】図1は、光情報記録媒体の構成を示す断 50

面模式図である。図6は、その光情報記録媒体の平面図(a)及び側面図(b)である。

【0003】この光情報記録媒体は、図1、6に示すよ うに、ポリカーボネート等からなる円板状の基板20上 に、スパッタ等により誘電体膜41,43(窒化シリコ ン等)、記録膜42(TbFeCo等)、反射膜44 (A 1等)等の薄膜からなる単層、または多層からなる 薄膜層40が形成されている。また、この薄膜層40上 に樹脂膜等による薄膜保護膜50が、基板の光入射面上 には樹脂等からなる基板保護膜30が形成されている。 これらのそれぞれの層及び膜の膜厚は、基板20が約 1.2〔mm〕、スパッタ等で形成される単層あるいは 多層薄膜層40の厚さは10~300〔nm〕、薄膜保 護膜50の厚さが1~30〔μm〕、基板保護膜30の 厚さが1~30 (μm)であり、全厚のほとんどがポリ カーボネイト基板20によって占められている。このた め光情報記録媒体の剛性は、そのほとんどが、ポリカー ボネート基板20に依存しており、ポリカーボネート基 板20が十分に厚いため、環境変化(温湿度変化)によ る変形は非常に小さかった。このため、通常は、各層に 発生する応力や曲げモーメントのバランスはほとんどの 場合考慮されていなかった。

【0004】しかしながら、光情報記録媒体においては、更なる高密度記録再生が求められており、収差の発生を抑制するために基板が薄型化する傾向(例1.2 【mm】厚→0.6 [mm]厚)にある。この場合、当然、光情報記録媒体の剛性は低下し、環境変化(温湿度変化)によって光情報記録媒体を形成している各層に発生する応力に起因する変形が大きくなり、情報の記録再生が困難になるという問題が生じる。したがって、基板が薄くなり剛性が低下した場合においても、対環境性能の高い光情報記録媒体が求められている。

【0005】光情報記録媒体の変形を抑制する手法として、特開平4-195745号公報には基板の裏面(薄膜層の形成されていない側の面)に反り防止用の誘電体膜を設ける手法が提案されている。

【0006】図7はこの光情報記録媒体の構成を示す断面図である。なお、図7において図1と同一部分については同一符号を付している。図7に示すように、ここでは、ボリカーボネート基板20の光入射側に誘電体層60を設けて、透明基板20の両側に位置する記録膜42.と誘電体層60との膨張率を同等とすることで、光情報記録媒体を透明基板20に対して対称構造として、これにより光情報記録媒体の反りを防止できるようにしている。

【0007】また、特開平10-64119号公報には、薄膜保護膜を厚く塗布することにより、光ディスクの温度上昇による反りを少なくすることが記載されている。

【0008】また、光情報記録媒体が湿度変化によって

3

反ることを問題として、図8に示すような、薄膜保護膜50、薄膜層40、基板20、基板保護膜30を有する光情報記録媒体において、基板20と基板保護膜30との間に $SiO_2$ やAlNからなる透湿防止膜70を設けたものが特開4-364248号公報で提案されている。なお、図8において図1と同一部分については同一符号を付している。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平4-195745号公報に記載の手法(図7参照)では、基板の光入射側にスパッタ等により誘電体層を設ける必要が有るため、生産において、基板に対して一方側の面に薄膜層を形成した後、その基板を引っ繰り返して反対側の面に誘電体層を形成する必要があり、工程が複雑化するとともに生産設備の高価格化を齎し、コストアップに繋がるという問題がある。

【0010】また、特開平10-64119号公報に記載の手法では、薄膜保護膜の膜厚が厚くなりすぎ、製造上難があるという問題がある。また、例えば、光情報記録媒体が光磁気記録媒体であった場合、記録時に印加する磁界を高速で反転させるには磁界発生手段と薄膜層とを近接することが望ましく、薄膜保護膜の膜厚が厚くなることは磁気特性の劣化を齎し、問題である。

【0011】さらに、特開平4-364248号公報に記載の手法(図8参照)でも、基板の光入射側にスパッタ等によりSiO,やAlNを設ける必要が有るため、生産において、基板に対して一方側の面に薄膜層を形成した後、その基板を引っ繰り返して反対側の面に誘電体層を形成する必要があり、工程が複雑化するとともに生産設備の高価格化を齎し、コストアップに繋がるという問題がある。

【0012】本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、温湿度変化に伴う変形(反り)を防止でき、且つ、その製造が容易な光情報記録媒体を提供することを目的とする。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の光情報記録媒体は、透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保 40 護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、記録再生時の温度変化による膜厚方向の変形の中立面が前記薄膜層近傍にあることを特徴とする。

【0014】請求項2に記載の光情報記録媒体は、透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、前記薄膜層近傍において、膜厚方向におけるその両側から受ける曲げモーメントが、略等しいことを特徴とする。

【0015】請求項3に記載の光情報記録媒体は、透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、前記薄膜保護膜は、そのヤング率及び線膨張係数の少なくとも一方が前記透明基板よりも大きいことを特徴とする。

【0016】請求項4に記載の光情報記録媒体は、請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の光情報記録媒体に10 おいて、前記薄膜保護膜の膜厚が、20μm以下であることを特徴とする。

【0017】請求項5に記載の光情報記録媒体は、透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、前記透明基板の光入射側に形成された樹脂を主成分とする基板保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、前記薄膜保護膜の透湿度より前記基板保護膜の透湿度が小さいことを特徴とする。

0 【0018】請求項6に記載の光情報記録媒体は、請求 項5に記載の光情報記録媒体において、記録再生時の温 度変化による膜厚方向の変形の中立面が前記薄膜層近傍 にあり、且つ、前記薄膜保護膜の膜厚が、前記基板保護 膜の膜厚よりも厚いことを特徴とする。

【0019】なお、請求項1において、変形の中立面とは、後述する式(1)~(5)において、反り角 $\theta$ が略 0となるときに、yの値により表される面を示している。

#### [0020]

① 【発明の実施の形態】(実施の形態1)以下、本実施の 形態の光情報記録媒体について説明するが、まず、本発明の原理を説明する。

#### 【0021】 ①原理

従来の技術の項で説明したように、特開平4-1957 45号公報(図7参照)に記載の光情報記録媒体では、 透明基板20に対して対称になるよう層を構成すること で、光情報記録媒体の反りを抑制していた。

【0022】これに対して、本発明者は、例えば、図1の断面模式図に示すような薄膜保護膜50,薄膜層4

0,透明基板20,基板保護膜30を有する光情報記録 媒体において、(a)薄膜層40を温度変化による変形 の中心とすること、すなわち、薄膜層に対して対称に構 成することで反りが抑制できる点、及び、(b)反りの 抑制に併せて薄膜保護膜50の膜厚を薄くできる点を見 出した。以下、さらに詳しく説明する。

【0023】図1に示すように、一般に、光情報記録媒体は、ポリカーボネート等の透明基板20上にスパッタ等により誘電体膜41、43(窒化シリコン等)、記録膜42(TbFeCo等)、反射膜44(A1等)等の薄膜からなる単層又は多層の薄膜層40を有し、その薄

4

膜層40上に樹脂を主成分とする薄膜保護膜50が形成 されているとともに、その透明基板20の反対の面上に 透明基板20を保護するために樹脂を主成分とする基板 保護膜30が形成されている。

【0024】このように光情報記録媒体は通常多層で構 成されており、このため、各層の物性値である線膨張係 数の相違等に起因して、温度変化時に各層に発生する応 力が異なる結果となる。具体的には、一般に、ポリカー ボネートからなる透明基板20、及び、基板保護膜3 0. 薄膜保護膜50の線膨張係数は薄膜層40のそれに 比較して大きく、薄膜層40の基板の半径方向への膨張 はその他の各層に比較して非常に小さくなる。また、透 明基板20の厚さは基板保護膜30及び薄膜保護膜50 の厚さに比較して非常に大きく、薄膜層40の各薄膜の ヤング率が他の層に比較して非常に大きくなる。このた め、温度変化が生じると、薄膜層40の膨張が小さいの 比して、透明基板20の膨張が大きくなり、結果的に、 光情報記録媒体10は半径方向に垂直で且つ膜厚方向に おいて薄膜保護膜50側に向かう反りが生じ易くなる。 図2はその反りを説明する模式図であり、(a)は平面 図、(b)は側面図である。

【0025】本実施の形態ではこの反りを防止するため に、薄膜層40上に形成される薄膜保護膜50の線膨張 係数、ヤング率、及び膜厚を調整することで、薄膜層4米 \* 0 に対して、透明基板 2 0 による曲げモーメントと逆向 きの曲げモーメント与え、そして、薄膜層40内に含ま れ、膜面と平行な面を変形の中立面とすることで、温度 変化による変形 (図2に示すような反り)を抑制する。 【0026】上記のような薄膜保護膜50の線膨張係 数、ヤング率、及び膜厚の設定は、次のような近似計算 によって行える。

【0027】光情報記録媒体10には、温度変化時に半 径方向に働く応力(軸力)と円周方向に働く応力と膜厚 方向に働く応力が発生するが、光情報記録媒体10は、 円板状であるため、円周方向に働く応力は円周内で均一 になり、膜厚方向の力も各層内では一様に働くため、変 形には寄与しないと仮定できるため、光情報記録媒体1 0の変形すなわち反り(図2参照)は、その断面部に相 当する多層はりにおける反りに置換できる。 図3はその 多層はりを示す図である。 なお、図3では n層はりを示 しているが、このnは光情報記録媒体の層数であり、図 1の光情報記録媒体の場合にはn=7である。

【0028】この多層はりにおける温度変化時の反り角 度 $\theta$  は各層の軸力P,  $(i=1, 2, \dots, n)$  と曲げモ ーメントM<sub>1</sub>の釣り合いから導かれる式(1)~(5) によって表わすことができる。

[0029] 【数1】

$$M_{i} = \frac{E_{i}I_{i}}{R_{i}}. \qquad (1)$$

$$\alpha_{i}T + \frac{P_{i}}{bt_{i}E_{i}} - \frac{t_{i}}{2R_{i}} = \alpha_{i+1}T + \frac{P_{i+1}}{bt_{i+1}E_{i+1}} + \frac{t_{i+1}}{2R_{i+1}}. \qquad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{n} P_{i} = 0. \qquad (3)$$

$$\sum_{i=1}^{n} M_{i} + P_{i}\left(y - \frac{t_{i}}{2}\right) + P_{2}\left(y - t_{i} - \frac{t_{2}}{2}\right) + \dots + P_{n}\left(y - t_{i} - t_{2} - \dots - \frac{t_{n}}{2}\right) = 0. \qquad (4)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{L-2}{R}\right). \qquad (5)$$

【0030】なお、式(1)~(5) における各記号

α、: i層の線膨張係数

E,: i層のヤング

t,:i層の厚さ

P<sub>1</sub>: i層における 40

M,: i層における曲げモーメント R;:曲率半径

I,: i層の断面2次モーメント

b:はりの幅(単

位長とする)

T:変化温度

L:はりの長さ

y: n層はりの中立面位置

 $\theta$ :最大変位部における長さ4mmでの反り角度を示し ている。また、各層の厚さは曲率半径に比較してはるか に小さいため、各層 (i=1,2,…,n) における曲 率半径は同一(R,=R,=R,=…=R)とする。ま

た、変化温度丁は光情報記録媒体の使用温度環境(一般 に-15℃~80℃)内における変化温度である。

【0031】そして、この式(1)~(5) においてy を薄膜層 4 0内に設定したときに θ が小さくなるよう に、すなわち曲率半径Rが大きくなるように各層(特に 薄膜保護膜50 (薄膜層40 については光情報記録媒体 の特性により予め決められているとが多い))の厚さ、 線膨張係数α、ヤング率Eを決定すれば、温度変化に伴 う図2の反りを抑制できる光情報記録媒体を得ることが できる。

【0032】ところで、光情報記録媒体において薄膜保 護膜50の膜厚が厚くなると、それをスピンコートで形 成することが難しくなる。また、光情報記録媒体が光磁 気記録媒体の場合には薄膜保護膜50の膜厚が厚くなる 50 と、磁気ヘッドと薄膜層40との距離が離れることにな

(5)

り、磁気特性上好ましくない。これらのことから薄膜保 護膜50の膜厚は30μm以下、更に良くは20μm以 下に設定することが望ましい。したがって、薄膜保護膜 50としては、上記膜厚条件(30 µm以下(望ましく は20μm以下))を満たすとともに、上記式(1)~ (5) において $\theta$ を小さくできる線膨張係数 $\alpha$ 、ヤング 率Eの材料を選定することが必要である。式(1)~ (5) によれば、線膨張係数 $\alpha$ 、ヤング率Eの少なくと も一方が大きければ、膜厚が小さくてもθを小さくする ことが可能である。

【0033】以上説明したように、本実施の形態の光情 報記録媒体では薄膜層40内に温度変化時における変形 の中立面がくるように各層(特に薄膜保護膜50)を設 定するため、反りの発生を抑制できる。また、光情報記 録媒体を構成している各層の中で変形速度の最も遅い薄 膜層40の変形がごく小さくなり、実際の温度変化時に 問題となる変位のオーバーシュートも小さなものにな る。さらに、透明基板20の光入射側には樹脂を主成分 とする基板保護膜30のみを形成すればよいため、スピ ンコート等により簡単に製造でき、製造工程を簡略化で 20 きる。

【0034】なお、上記説明では、光情報記録媒体を構 成する全ての層の材料特性を用いて、温度変化による変 形の中立面が薄膜層40の内部に存在するように、各層 (特に薄膜保護膜50)の設定を行うことについて述べ たが、一般に、光情報記録媒体における薄膜層40を構 成する各層は非常に薄いものであるため、薄膜層40を 1つの層と見なして、薄膜層40に対してその両側(一 方側が透明基板20及び基板保護膜30、他方側が薄膜 保護膜50)が温度変化により与える曲げモーメントが\*30

\*略打ち消し合うように、各層(特に薄膜保護膜50)を 設定しても良い。この場合でも、薄膜層40の温度変化 による反りを略無くすことができる。このとき、薄膜保 護膜50の膜厚を小さくする(30μm以下(望ましく は20μm以下))には、透明基板20の厚さが大きい ことを鑑みると、薄膜保護膜50の線膨張係数α. ヤン グ率Eの少なくとも一方は、透明基板20よりも大きい ものである必要がある。

【0035】②実施例

10 次に、上記原理に基づき形成した光情報記録媒体の実施 例について説明する。なお、本実施例は、薄膜層40が 窒化アルミニウム1層のみからなると仮定している。と れは、薄膜層40の変形は一般に窒化アルミニウム等の 誘電体層が主にその原因となる場合が多いからである。 また、本実施例では基板保護膜30が無い例を示してい る。基板保護膜30が存在する場合にはそれをも考慮し て各層(特に薄膜保護膜50)の設定を行う必要があ る。

【0036】実施例1として、ポリカーボネイト基板 (透明基板20)上に、窒化アルミニウム薄膜層(薄膜 層40)と式(1)~(5)を用いて設計された条件の 紫外線(UV)硬化樹脂1(薄膜保護膜50)が形成さ れた媒体を形成した。また、比較例1として、ポリカー ボネイト基板上に、窒化アルミニウム薄膜層と従来の紫 外線(UV)硬化樹脂2(薄膜保護膜)が形成された光 情報記録媒体を形成した。表1,2にそれぞれ実施例 1. 比較例1の構成を示す。

[0037]

【表1】

	材質	膜厚	ヤング率(Pa)	線膨張係数(1/℃)
透明基板	ポリカーボネイト	0.6mm	2.41E+09	6.00E-05
薄膜層	窒化アルミニウム	79nm	3.43E+11	5.60E-06
薄膜保護層	UV硬化樹脂1	16 µ m	1.80E+09	7.10E-05

[0038]

#### ※ ※ 【表2】

	材質	膜厚	ヤング率(Pa)	線膨張係数(I/℃)
透明基板	ポリカーボネイト	0.6mm	2.41E+09	6.00E-05
薄膜層	窒化アルミニウム	79nm	3.43E+11	5.60E-06
薄膜保護層	UV硬化樹脂2	15 µ m	1.80E+09	5.62E-05

【0039】表1、2から分かるように、両者の違い は、主にUV硬化樹脂(薄膜保護膜50)の線膨張係数 であり、実施例1の方が線膨張係数が大きいものを使用 している。なお、透明基板20としては、両者とも内径 φ15mm, 外径120mmのものを使用している。

【0040】実施例1と比較例1の媒体に対して25℃

えて、そのときの外周部(r=56mm)での反り角 $\theta$ の変化量の経時変化を測定した。なお、反り角そのもの でなく反り角の変化量を測定した理由は、常温状態にお いて、媒体は独自の反り角を持っているため、温度変化 による変形を示すには不適格であるためである。

【0041】図4はその結果を示す図である。実施例1 →55℃に上昇する温度変化(上記のT≈30℃)を与 50 の媒体の反り角の変化量は、最大値及び定常状態値のい ずれも比較例1の媒体よりも小さく、変形を抑制していることが分かる。また、この図から、実施例1によれば、 $20\mu$ m以下の膜厚であっても、温度が変化により一時的にも大きな反りが生じることがないことが分かる。さらに、図4には、上記式(1)~(5)を用いて予想した反り角 $\theta$ の変化量を併記しているが、上記式

(1)~(5) による近似が実測値に非常に近く、その\*

\* 近似は実際に適合していることが分かる。

【0042】次に、ヤング率の大きなUV硬化樹脂3を使用した媒体(実施例2)について説明する。この実施例2の媒体は実施例1の媒体とUV硬化樹脂の特性が異なっているものである。表3に実施例2の構成を示す。【0043】

【表3】

tts /54 o

	材質	膜厚	ヤング率(Pa)	線膨張保数(1/°C)
透明基板	ボリカーボネイト	0.6mm	2.41E+09	6.00E-05
薄膜層	窒化アルミニウム	79nm	3.43E+11	5.60E-06
薄膜保護層	UV硬化樹脂3	16 µ m	3.60E+09	5.68E-05

 $\{0\ 0\ 4\ 4\}$  との実施例2 の媒体について、上記式  $(1)\sim(5)$  を用いて反り角 $\theta$ の変化量を予想する と、その値は5.  $1\ 8$   $\{m\ r\ a\ d\}$  であり、上述の比較 例1 に比して大幅に温度変化に起因する反りが減少して いることが分かる。

【0045】以上のように、本実施の形態の光情報記録 媒体によれば、温度変化により一時的にも大きな反りが 20 生じることを抑制できるため、記録再生時の温度上昇に よても再生不良等の問題が生じることを抑えることがで きる。また、薄膜保護膜50の膜厚を薄くすることがで きる。

【0046】(実施の形態2)本実施の形態では、湿度変化による変形を防止できる光情報記録媒体について説明する。

#### 【0047】①原理

上述した図1に記載の光情報記録媒体10は、透明基板20としてポリカーボネート等からなる基板を用いてい 30るため、周辺が高湿となったとき、透明基板20が吸湿により膨張する。そして、これにより光情報記録媒体1※

※ 0 に変形が生じる。特に、基板保護膜30の透湿度が薄膜保護膜50の透湿度に比較して大きい場合は、基板20の変形速度が薄膜保護膜50の変形速度より大きくなるため、実際の湿度変化時に大きな変位のオーバーシュートが起き実用上において大きな問題となっていた。

[0048] 本実施の形態では、基板保護膜30の透湿度を薄膜保護膜50の透湿度に比較して小さくして、このオーバーシュートを抑制しすることにより、実用時における問題を解決する。

#### 【0049】②実施例

実施例3として上述の実施例1に記載の媒体にUV硬化 樹脂4からなる基板保護膜30を付加した媒体を形成し た。また、比較のため、比較例2として、上述の実施例 1に記載の媒体にUV硬化樹脂5からなる基板保護膜3 0を付加した媒体を形成した。との実施例3,比較例2 における各UV硬化樹脂の透湿度について表4に示す。 【0050】

【表4】

	基板	呆護膜	薄膜保護膜		
	模種	透湿度(g/m²·day)	模種	透湿度(g/m²·day)	
実施例3	UV硬化樹脂4	2.20E+02	UV硬化樹脂 1	4.60E+02	
比較例2	UV硬化掛脂5	9.70E+02	UV硬化樹脂 1	4.60E+02	

【0051】この実施例3、比較例2の媒体に対して、 湿度変化(周囲湿度を $50\% \rightarrow 90\%$ に変化)を与え て、各媒体の外周部(r=56mm)における反り角 $\theta$ の変化量の経時変化を測定した。

【0052】図5はその結果を示す図である。実施例3の反り角の変化量の最大値(オーバーシュート時に発生)は比較例2のそれに比較して非常に小さなものとなり、湿度変化による変形が抑制されていることがわかる。

【0053】このように本実施の形態の光情報記録媒体によれば、湿度が変化しても一時的にも大きな反りが生じることがなく、記録再生時に再生不良等の問題が生じることを抑制できる。

(0054)なお、本実施の形態の光情報記録媒体においても、実施の形態1に記載のように薄膜層40内に温 6変化による変形の中立面を有するように、また、薄膜層40に対してその両側(一方側が透明基板20及び基板保護膜30、他方側が薄膜保護膜50)が温度変化により与える曲げモーメントが略打ち消し合うように、薄膜保護膜50及び基板保護膜30の設定を行えば、本実施の形態における湿度変化に起因する変形の防止のみならず、温度変化に起因する変形をも防止することができ

【0055】上記のように変形の中立面を薄膜層40内 に設ける場合には、一般に光ビームの入射側となる基板 50 保護膜30の膜厚は、薄膜保護膜50の膜厚より薄い方 が良いため、それを満たすような線膨張係数等を有する 保護膜材料を選択することが望ましい。

【0056】なお、以上の実施の形態では変形の中立面 が薄膜層内に位置するように媒体を構成したが、薄膜層 近傍にあっても良い。勿論、薄膜層内にあることが変形 量を減少させる上で望ましい。

【0057】以上の実施の形態1、実施の形態2におい\*

\* て説明した本発明の原理は、実施例1~3より薄いポリカーボネイト基板等を用いた場合においても成り立つ。 その具体例について、以下に説明する。

【0058】実施例4として、板厚0.5mmの透明基板を用い、下記表5に示す構成の媒体を形成した。 【0059】

【表5】

			• • • •			
	材質 _	膜厚	ヤンク <sup>*</sup> 亭(Pa)	線膨張係数 (1/C)	透漫度 (g/m²·day)	
基板保護膜	UV 硬化樹脂 6	3 µ m	6.8E+9	5.0E - 5	2.2E+2	
透明基板	な "リカーオ"ネイト	0.5mm	3.3E+9	6.0E-5		
薄膜層	空化がに効 .	79nm	3.4E+11	5.6E-6		
薄膜保護膜	UV 硬化樹脂 7	12 µm	5.9E+9	7.2E-5	4.6E+2	

【0060】との実施例4の媒体の温度変化時、及び湿度変化時における反り角 $\theta$ の変化量を測定した。図9、10はその結果を示す図である。なお、透明基板の大きさは、内径 $\phi$ 7 mm、外径 $\phi$ 5 0 mmである。

【0061】図9は、雰囲気を温度25℃湿度50%から温度70℃湿度30%に変化させたときの媒体の外周部における反り角θの変化量を示している。この結果で20は、基板厚がより薄い(実施例4では0.5mm)場合においても、温度変化時における反りの変化量は3mrad程度であった。従来の手法により表5の条件の薄い透明基板を用いた場合、反りの変化量が10mradはるかに超えていたため、本発明により反りの変化を大幅に抑制できることがわかる。

【0062】また、図10は雰囲気を温度25℃湿度60%から温度25℃湿度90%に湿度を変化させたときの媒体の外周部における反り角 $\theta$ の変化量を示している。この結果より、基板厚がより薄い(実施例4では $0.5\,\mathrm{mm}$ )場合においても、湿度変化時における反りの変化量が非常に小さいことが分かった。

#### [0063]

【発明の効果】本発明では、光情報記録媒体を温度変化 による変形時の中立面が磁性膜等の薄膜層近傍(望ましくは薄膜層内)にあるように構成することにより、温度 変化時における変形量を小さくして、記録再生の信頼性を高めることができる。

【0064】また、上記光情報記録媒体において、透明 基板よりもヤング率、線膨張係数の少なくとも一方が大 40 きな薄膜保護膜を設けることにより、薄膜保護膜の膜厚 を薄くできる。これにより製造が容易になると共に、光 磁気記録媒体の場合、その磁気特性を向上することができる。

【0065】また、光情報記録媒体において薄膜保護膜の透湿度より小さい透湿度を有する基板保護膜を設ける

ことにより、湿度変化時における変形量が小さくなり、 記録再生の信頼性を高めることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】光情報記録媒体の構成を示す断面模式図である。

【図2】光情報記録媒体の反りを説明する図である。

【図3】多層はりを説明する図である。

【図4】温度変化時における反り角の変化量の時間依存性を示す図である。

【図5】湿度変化時における反り角の変化量の時間依存性を示す図である。

【図6】光情報記録媒体の構成を示す平面図、側面図である。

【図7】従来の光情報記録媒体の一例を示す断面模式図 である。

【図8】従来の光情報記録媒体の他の例を示す断面模式 図である。

【図9】板厚0.5mmの光記録媒体の温度・湿度を変化させたときの反り角の変化量の時間依存性を示す図である。

【図10】板厚0.5mmの光記録媒体の湿度変化時における反り角の変化量の時間依存性を示す図である。

#### 【符号の説明】

- 10 光情報記錄媒体
- 20 透明基板
- 30 基板保護膜
- 0 40 薄膜層
  - 41 第1誘電体膜
  - 42 記錄膜
  - 43 第2誘電体膜
  - 4.4 反射膜
  - 50 薄膜保護膜

